

鹿児島工業高等専門学校		開講年度	平成29年度 (2017年度)		授業科目	知的財産概論
科目基礎情報						
科目番号	0041		科目区分	一般 / 選択		
授業形態	講義		単位の種別と単位数	学修単位: 2		
開設学科	機械工学科		対象学年	5		
開設期	前期		週時間数	2		
教科書/教材	産業財産権標準テキスト総合編／書いてみよう特許明細書出してみよう特許出願 産業財産権標準テキスト特許編					
担当教員	蓼沼 恵美子					
到達目標						
1. 知的財産について説明できる。 2. 発明から特許権になるまでを説明できる。 3. デザインから意匠権になるまでを説明できる 4. 標章から商標権になるまでを説明できる 5. 知的財産の活用方法について説明できる。 6. 著作権の対象となるもの、およびどのようなことが著作権侵害になるかを説明できる。 7. 不正競争防止法による禁止事項を説明できる。 8. パテントコンテスト・パテントデザインコンテストを通じて、自らの発明を文章と図で表現することができる。						
ルーブリック						
	理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安	
評価項目1	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 製品のどの部分にどの知的財産権が関与しているかが説明できる。		知的財産権の種類について説明できる。		知的財産権の種類がわからない。	
評価項目2	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 1) 職務発明・共同発明について説明できる。 2) 補正の条件や認められている理由について説明ができる。		1) 発明の定義を説明でき、発明となるもの、ならないものを判別できる。 2) 発明が特許となる要件（特許要件）について説明できる。 3) 特許出願から権利化までの流れについて説明できる。		発明となるものとならないものとの判別ができない。 発明と特許の違いがわからない。 特許出願後の流れがわからない。	
評価項目3	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 意匠権の効力、効力が及ぶ範囲について説明できる。 意匠と特許とは、異なる制度があること、また、異なる制度となっている理由を説明できる。		1) 意匠の定義を説明でき、意匠となるもの、ならないものを判別できる。 2) 意匠権となる要件について説明できる。 3) 各種意匠制度について説明できる。		意匠となるものとならないものとの判別ができない。 意匠権となる要件がわからない。 各種意匠制度がわからない。	
評価項目4	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 商標権の効力、効力が及ぶ範囲について説明できる。 商標調査を実施できる。		1) 標章、商標の定義、違いを説明できる。 2) 商標の機能について説明できる。 3) 商標権とならない商標について説明できる。		標章と商標との違いがわからない。 商標の機能がわからない。	
評価項目5	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 権利侵害とはならない例外ケースについて説明できる。		1) 知的財産の活用方法について説明できる。 2) 権利侵害とはどのようなことか、また、権利侵害時の対応手段について説明できる。		知的財産の活用方法がわからない。 権利侵害がわからない。	
評価項目6	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 著作権に含まれる主な権利について説明できる。		1) 著作権の保護対象となるものとならないものを判別できる。 2) 著作権侵害となる行為が否かを判断できる。		著作権の保護対象となるものか、ならないものを判別できない。 著作権侵害となる行為を理解できない。	
評価項目7	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 不正競争防止法による禁止事項を説明できる。		事例について、不正競争防止法による禁止事項に該当するか否かを判断できる。		事例について、不正防止法による禁止事項に該当するか否かを判断できない。	
評価項目8	標準的な到達レベルに加えて、以下のことができる。 発明またはデザインについて、先行調査を行い、新規性・進歩性があることを立証できる。		自身がした発明またはデザインを文章・図で、読む人にわかるように記載することができる。		自身がした発明またはデザインを説明した文章・図面を読んだ人が、発明またはデザインが把握できない。	
学科の到達目標項目との関係						
JABEE 1(2)(b) JABEE 1(2)(d)(3) JABEE 1(2)(f) 教育プログラムの科目分類 (1)① JABEE (2012) 基準 1(2)(b) JABEE (2012) 基準 1(2)(d)(3) JABEE (2012) 基準 1(2)(f) 教育プログラムの学習・教育到達目標 2-2 本科（準学士課程）の学習・教育到達目標 2-a 教育プログラムの学習・教育到達目標 4-2 本科（準学士課程）の学習・教育到達目標 4-a						
教育方法等						
概要	知的財産権について理解し、その重要性を認識し、それぞれのアイデアを権利化できるような素養を身につけることを目的とする。					
授業の進め方・方法	1. 知的財産権～7. 不正競争防止法までは、座学にて習得する。8. 実習では、1～3人程度のグループで発明またはデザインをし、パテントコンテストまたはパテントデザインコンテストの応募書類の作成を通して、発明、またはデザインを文章・図で説明することを習得する					
注意点	国民的素養としてのモラル・マインドを身につけ、制度を理解するだけでなく、創造力の育成をめざしている。そのため学習上だけでなく生活する上でも知識や知恵を生かす大切さや創意工夫をする態度を持って過ごすことが望まれる。					
授業計画						
	週	授業内容			週ごとの到達目標	

前期	1stQ	1週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		2週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		3週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		4週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		5週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		6週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		7週	1. 知的財産権 2. 特許・実用新案 3. 意匠 4. 商標	☐ 知的財産について理解し、説明できる。 ☐ 発明について理解し、説明できる。 ☐ 特許を出願する方法を説明できる。 ☐ 特許の出願～権利化までの過程について説明できる。 ☐ 実用新案について説明できる。 ☐ 意匠について理解し、説明できる。 ☐ 意匠法特有の制度について説明できる。 ☐ 商標について理解し、説明できる。
		8週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。
	2ndQ	9週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。

		10週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。
		11週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。
		12週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。
		13週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。
		14週	5. 活用 6. 著作権 7. 不正競争防止法 8. 実習	☐ 商標登録をうけることができる商標について説明できる。 ☐ 商標の類比判断について説明できる。 ☐ 知的財産の活用について説明できる。 ☐ 著作権について説明できる。 ☐ 不正競争防止法について説明できる。 ☐ 発明または意匠を創作することができる。 ☐ 特許・意匠について調査できる。 ☐ 各自の発明をパテントコンテストまたはパテントデザインコンテストに応募するために書類を作り上げることができる。
		15週	試験答案の返却・解説	各試験において間違えた部分を自分の課題として認知する。（非評価項目）
		16週		

評価割合

	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	80	0	0	0	0	20	100
基礎的能力	80	0	0	(-10)	0	20	100
専門的能力	0	0	0	0	0	0	0
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0